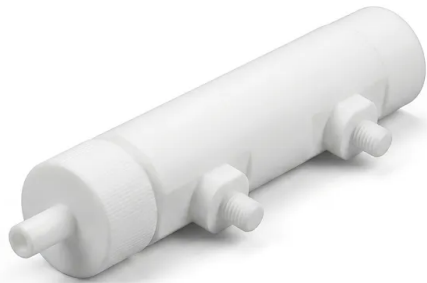


# 用于半导体和多晶硅工业应用的高纯度定制 PTFE 反应槽电解槽

货号: PL-CP108



## 简介

探索专为半导体和多晶硅制造设计的定制 PTFE 反应槽和电解槽。这些耐腐蚀装置确保了痕量分析和化学处理过程中的高纯度，为苛刻的实验室和工业应用提供了无与伦比的耐用性和热稳定性。

## [了解更多](#)

应用	描述	主要优势
半导体晶圆清洗	在光刻工艺中用作硅晶圆超纯酸清洗的定制槽。	防止金属离子污染。
多晶硅化学气相沉积	用于处理太阳能和电子级硅生产中试剂的高纯度容器。	保持高纯度前体完整性。
电化学研究	用于测试新电池化学和电镀工艺的定制电解槽。	消除与容器壁的副反应。
痕量金属分析	用于环境测试中要求万亿分之一纯度水平的样品的储存和反应容器。	提供最低的可浸出物特性。
等离子体蚀刻支持	等离子体腔内使用的组件护罩和保护器，用于保护精密仪器。	对等离子体侵蚀具有卓越的抵抗力。
腐蚀性流体输送	用于处理氢氟酸和其他侵蚀性蚀刻剂的定制歧管和反应槽。	最大的操作员安全性和设备寿命。
高温合成	用于涉及侵蚀性有机催化剂的水热或回流过程的反应容器。	在升高的温度下连续运行。
定制实验室设置	设计与自动化传感器和流体控制器集成的专用反应器。	与现有基础设施无缝集成。

参数组	规格详情	产品项目编号
材料构造	高纯度原生 PTFE / PFA (根据客户要求)	PL-CP108
尺寸规格	完全可定制 / 根据客户技术图纸	PL-CP108
端口配置	定制螺纹端口、法兰或锥形接头	PL-CP108
温度额定值	材料热极限 (特定于应用)	PL-CP108
耐化学性	通用 (除高温下的熔融碱金属和氟气外)	PL-CP108
制造方法	精密 CNC 加工和定制车削	PL-CP108
表面光洁度	高级光滑表面处理，以最大程度减少残留物	PL-CP108
盖子设计	定制螺栓、螺纹或压配合选项	PL-CP108
容积容量	根据特定工业或实验室要求定制	PL-CP108
壁厚	针对压力和热要求进行工程设计	PL-CP108